

CVD 氧化硅硅基底单层二硫化钼

中文名称： CVD 氧化硅硅基底单层二硫化钼

英文名称： Single Layer MoS₂ on SiO₂/Si

货 号： ML1090

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 1 盒

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

基 底： 二氧化硅/硅

基底尺寸： 8 mm*6 mm

氧化层： 300nm

片径范围： 20-50 μ m

厚度： 0.6~0.8 nm

应用： 酶联生物最新推出 CVD 法制备的单层二硫化钼，相比较锂插层制备的单层二硫化钼，该产品具有缺陷少，层数可控，优异的光学性质，是研究层数和荧光效应和制备器件的优异材料，欢迎咨询